

足立の事業所土壤汚染

地中にTCB原液滞留

インキ大手の大日精化工業(本社・中央区)の東京製造事業所(足立区堀之内1)の敷地内で、環境基準を超えるダイオキシン類が地下水などから検出された問題で、同社は28日記者会見し、敷地内の地中に高濃度のダイオキシンを含むトリクロベンゼン(TCB)の原液が滞留していると発表した。

同社では、地下水の汚染状況を調べるため、敷地内に観測用の井戸を掘った。その結果、深さ18〜27メートルの「第二帯水層」で、顔料の製造工程で使用するTCBを検出した。ダイオキシン濃度は1立方センチメートルあたり39万ポピコで、地下水の環境基準の約39万倍だった。同社は、「工場から漏れたTCB原液が土壤に浸透後、地下水に混ざらずに滞留して存在している状態と考えられる」と説明している。

同社は「TCB原液が、地下水に触れて拡散する」とは「としない」とするが、今後、TCBの滞留している土壤を撤去する方針だという。同社は、地下水から環境

基準の25倍のダイオキシン類が検出された事実などを26日発表していたが、TCB原液の滞留については公表していなかった。

同社の坂口恒久事業所長は、「大きな数値が独り歩きすると困ると思った」と釈明したが、「発表が遅れたのは良くなかった。今後、周辺住民に説明したい」と述べた。

同社では、地下水の汚染状況を調べるため、敷地内に観測用の井戸を掘った。その結果、深さ18〜27メートルの「第二帯水層」で、顔料の製造工程で使用するTCBを検出した。ダイオキシン濃度は1立方センチメートルあたり39万ポピコで、地下水の環境基準の約39万倍だった。同社は、「工場から漏れたTCB原液が土壤に浸透後、地下水に混ざらずに滞留して存在